

## 高真空蒸着装置 ED-1500



高真空蒸着装置ED-1500は金属・誘導体・半導体等を成膜するための蒸着装置で、電子銃5kWのルツボ4ヶ搭載しております。

基板ホルダーはリフトオフ対応。基板加熱はプレートヒーターを採用し300℃まで昇温可能です。排気系動作は自動。成膜制御も電子銃制御装置と水晶振動式膜厚計の連動により膜厚レートの制御を自動的に行います。

### 高真空蒸着装置 ED-1500 仕様

- 到達圧力 7.0×10<sup>-4</sup>Pa以下※無負荷・常温時
- 排気速度 ×10<sup>-4</sup>Pa迄本引開始後30分以内※無負荷・常温時
- 真空漏洩量 1.0×10<sup>-10</sup>Pa・m<sup>3</sup>/sec Heリークデテクター検査
- 真空室径 φ500mm×624mmH 薄鋒型前扉式
- 蒸着機構 電子衝撃(EB)方式  
電子銃最大投入電力:5kW  
ルツボ容量:2.9mL  
ルツボ個数:4個  
ビーム偏向角:225度  
電源出力電圧:DC-4~10kV  
電源出力電流:DC0~500mA
- 基板形状 φ212mm
- 基板回転 回転数:0~19rpm
- 基板加熱 最高温度:450℃
- 膜厚計 水晶振動式膜厚計
- 真空排気系 油回転ポンプ:800L/min[60Hz]  
ターボ分子ポンプ:300L/sec
- 真空計 広帯域真空計
- 操作方法 自動
- ユーティリティ電 気:AC200V三相12.0kVA  
冷却水:10.0L/min以上0.03MPa以上0.1MPa以下25℃以下循環  
寸 法:装置架台本体:990mmW×1086mmD×(1783)mmH  
制御盤:570mmW×1000mmD×(1839)mmH
- オプション 冷却用チラー  
冷却能力:1200W(at液温10℃時)  
外部循環能力:最大18L/min  
最大揚程 13m[60Hz]

